1P047

パルス面積を用いた 型3準位系の量子制御

(慶大理工) 常盤浩太郎、菅原道彦、藪下聡

【序】分子とレーザーのコヒーレントな相互作用を利用した 量子制御法は分子の量子状態分布の反転、移動を実現するた めの有用な手段である。本研究では、共鳴条件化の型3準 位系の分布を、パルス面積を変化させることによって制御す るレーザー場の理論設計を行った。



【理論】図 1 のような準位 $|1\rangle$ - $|3\rangle$ 間の光学遷移が禁制である 型 3 準位系について考える。 準位 $|1\rangle$ - $|2\rangle$ 間の励起を起こさせる角振動数 ω_{12} 、強度 ε のパルスレーザー と、準位 $|2\rangle$ - $|3\rangle$ 間の励起を起こさせる角振動数 ω_{23} 、強度 ε のパルスレーザー は、共通の形状関数 f(t)を 用いてそれぞれ $\varepsilon f(t)$ 、 $\varepsilon f(t)$ と表されるものとする。レーザー場を量子化すると共に、分 子とレーザー場の相互作用に双極子近似を適用し、シュレディンガー方程式を解析的に解く。 波動関数を以下のように展開すると、

$$|\Psi(t)\rangle = c_1(t)\exp(i\omega_{12}t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle + c_3(t)\exp(i\omega_{23}t)|3\rangle$$
(1)
展開係数 $c_i(t)$ は形状関数の時間積分値 $\tau = \int_0^t dt f(t)$ を用いて以下のように表される。

$$c_{1}(\tau) = \frac{S(c_{1}(0)S - c_{3}(0)\eta) + S(c_{1}(0)S + c_{3}(0)S) \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{S^{2} + S^{2}}\right) - ic_{2}(0)S\sqrt{S^{2} + S^{2}} \sin\left(\frac{1}{2}\sqrt{S^{2} + S^{2}}\right)}{S^{2} + S^{2}}$$

$$c_{2}(\tau) = \frac{c_{2}(0)\sqrt{S^{2} + S^{2}} \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{S^{2} + S^{2}}\right) - i(c_{1}(0)S + c_{3}(0)S) \sin\left(\frac{\tau}{2}\sqrt{S^{2} + S^{2}}\right)}{\sqrt{S^{2} + S^{2}}}$$

$$c_{3}(\tau) = \frac{S(c_{3}(0)S - c_{1}(0)S) + S(c_{1}(0)S + c_{3}(0)S) \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{S^{2} + S^{2}}\right) - ic_{2}(0)S\sqrt{S^{2} + S^{2}} \sin\left(\frac{1}{2}\sqrt{S^{2} + S^{2}}\right)}{S^{2} + S^{2}}$$

$$(2)$$

ここで、*S* はレーザーパルス のパルス面積であり、 $|1\rangle$ - $|2\rangle$ 間の遷移双極子モーメント μ_{12} 、 レーザー場の偏光ベクトル κ 、レーザー の強度 ε から $S = |\mu_{12} \cdot \kappa| \varepsilon \tau/\hbar$ で定められる無次元 量である。*S* も同様に $|2\rangle$ - $|3\rangle$ 間の遷移双極子モーメント μ_{23} とレーザー の強度 ε から $S = |\mu_{23} \cdot \kappa| \varepsilon \tau/\hbar$ と決まる。(1)式は、系の最終状態 $|\Psi\rangle$ がパルスの形状に無関係で、パルス 面積のみに依存することを示している。以下ではパルス照射により任意の初期条件から、任 意の準位分布を実現させる様にパルス面積*S*、*S* を設計することを目的として議論する。

【結果】パルス面積をS = AS とパルス面積比Aを用いて表す。初期状態として準位 $|1\rangle$ にと り、目標分布を $|c_1|^2 = 1 - m - n$ 、 $|c_2|^2 = m$ 、 $|c_3|^2 = n$ と設定し、(1)、(2)式をAとS について 解くと、

$$A = \frac{1 \pm \sqrt{1 - m - n}}{\sqrt{n}} \qquad (3) \qquad \qquad S = \frac{2 \left[\pm \arccos\left[\frac{A - (1 + A^2)\sqrt{n}}{A}\right] + 2\pi N\right]}{\sqrt{1 + A^2}} \qquad (4)$$

と求まり、最大 4 通りの解が存在することが明らかになった。それぞれの解について、 c_i の 相対位相が異なっており、分布の割り振りだけでなく、相対位相の制御も可能であることが わかった。例として、 $|c_1|^2 = 0.3$ 、 $|c_2|^2 = 0.2$ 、 $|c_3|^2 = 0.5$ を目標分布に、パルス形状関数 $f(t) = e^{-(t-50)^2/T^2}$ としてパルスを設計した。(3)、(4)式より目標分布を実現する*S* と*S* の値は 4 組求められ、それぞれパルス照射後に異なる c_i の相対位相関係 ~ を実現することがわ かった(表1参照)。このとき、パルス照射中の分布の時間発展は図 2 に示すように、 ~ で異なっている。すなわち、異なる相対位相関係を実現するためにはパルス照射中の分布の 時間発展の違いが重要であることがわかった。

ある初期条件に設定した場合、(2)式より比例定数 A が解析的に表されるとき、その初期条件からの実現可能な準位分布を求めることができる。例えば、 $c_1(0) = 1/\sqrt{2}$ 、 $c_2(0) = 1/\sqrt{2}$ 、 $c_3(0) = 0$ のときは $0 \le |c_1|^2$, $|c_2|^2$, $|c_3|^2 \le 1/2$ の範囲で実現可能である。また、 $c_1(0) = 1/\sqrt{2}$ 、 $c_2(0) = 0$ 、 $c_3(0) = 1/\sqrt{2}$ のときは $0 \le |c_1|^2$, $|c_2|^2$, $|c_3|^2 \le 1$ となり、どの様な分布も実現可能である。一方、 $c_1(0) = \sqrt{3}/2$ 、 $c_2(0) = 1/2$ 、 $c_3(0) = 0$ のときは図 3の斜線で示された範囲の準位分布を実現でき、複雑な様相を呈する。



図2 相対位相関係



|| WX for $|c_2|$. A for $|c_2|$



図 3 初期条件 $c_1(0) = \sqrt{3/2}$ 、 $c_2(0) = 1/2$ 、 $c_3(0) = 0$ から実現可能である準位分布

表1 設計されたパルス面積と 終状態における相対位相の関係

S	2.330	4.440	4.780	6.650
S	3.643	6.943	2.184	3.038
c_1 の位相	0	0		
c ₂ の位相	- /2	/2	- /2	/2
C ₃ の位相				